

重新查詢

友善列印

0971學期 課程基本資料

系所 / 年級	資工系碩士班 2年級	課號 / 班別	65M00064 / A
學分數	3學分	選 / 必修	選修
科目中文名稱	積體電路製造實務	科目英文名稱	
主要授課老師	曹世昌	開課期間	一學期
人數上限	14 人	已選人數	14人

起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間

第1週 / 第18週 / I320 / 星期二第05節
第1週 / 第18週 / I320 / 星期二第06節
第1週 / 第18週 / I320 / 星期二第07節

請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

教學綱要

一、教學目標(Objective)	01. 半導體簡介(Introduction to Semiconductor) 02. 半導體電子元件(Semiconductor Basic Electronic Devices) 03. N MOS的製程(Fabrication of N MOS) 04. CMOS的製程(Fabrication of CMOS) 05. NMOS電晶體(MOS Transistor) 06. CMOS電晶體(CMOS Transistor) 07. CM
二、先修科目(Pre Course)	
三、教材內容(Outline)	培養學生對半導體及VLSI NMOS、CMOS製程的基本觀念，並熟悉CMOS電晶體的特性、基本電路邏輯及基本單元電路設計，使同學具備有基礎之VLSI設計基礎。
四、教學方式(Teaching Method)	講授
五、參考書目(Reference)	VLSI 設計概論(Basic VLSI Design)PUCKNELL DOUGLAS A., ESHRAGHIAN KAMRAN, 楊志能Prentice Hall of India, 高立圖書有限公司

2008/9/17	SEMICONDUCTOR BASICS	曹世昌
2008/9/24	SEMICONDUCTOR BASICS	曹世昌
2008/10/1	INTRODUCTION TO IC FABICATION	曹世昌
2008/10/8	WAFER MANUFACTURING THERMAL PROCESSES	曹世昌
2008/10/15	PHOTOLITHOGRAPHY PLASMA BASICS	曹世昌
2008/10/22	ION IMPLANTATION ETCH	曹世昌
2008/10/29	CVD AND DIELECTRIC THIN FILM METALLIZATION	曹世昌
2008/11/5	CMP(Chem Mechanical Polishing)	曹世昌

六、教學進度(Syllabi)	2008/11/12 期中考	曹世昌
	2008/11/19 PROCESS INTEGRATION	曹世昌
	2008/11/26 PROCESS INTEGRATION	曹世昌
	2008/12/3 CMOS PROCESSES	曹世昌
	2008/12/10 CMOS PROCESSES	曹世昌
	2008/12/17 CMOS PROCESSES	曹世昌
	2008/12/24 SUMMARYAND FUTURE TRENDS	曹世昌
	2008/12/31 SUMMARYAND FUTURE TRENDS	曹世昌
	2009/1/7 SUMMARYAND FUTURE TRENDS	曹世昌
	2009/1/14 期末考	曹世昌

七、評量方式(Evaluation) Class Participation、Homework Assignments、Mid-term Exam、Final Exam。

八、講義位址(<http://>)

九、教育目標

重新查詢